(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-330845

(43)公開日 平成5年(1993)12月14日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 3 B	37/018	Z			
	20/00				
	37/014	Z			
// G02B	6/00	356 A	7036-2K		

審査請求 未請求 請求項の数5(全 4 頁)

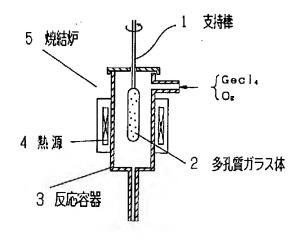
(21)出願番号	特願平4-142257	(71)出顧人 000002130
		住友電気工業株式会社
(22)出顧日	平成4年(1992)6月3日	大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5 番33号
		(72)発明者 浦野 章
		神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電
		気工業株式会社横浜製作所内
		(72)発明者 金森 弘雄
		神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電
		気工業株式会社横浜製作所内
		(72)発明者 石川 真二
		神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電
		気工業株式会社横浜製作所内
		(74)代理人 弁理士 上代 哲司 (外1名)

(54)【発明の名称】 光ファイバ用母材の製造方法

(57)【要約】

【目的】 ドーピング物質を効率よく、かつ、均一に添加する光ファイバ用母材の製造方法に関する。

【構成】 最初に多孔質ガラス体2を形成し、その後、酸素と反応して屈折率を高めるドーパントの酸化物を生成する金属ハロゲン化物を酸素と共に供給した反応容器3の雰囲気中で加熱処理する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 SiOzを主成物とする多孔質ガラス体 を形成し、該多孔質ガラス体を少なくとも02及びこれ と熱反応してガラスの屈折率を高めるドーパントの酸化 物を生成する金属ハロゲン化物とを含む雰囲気におき、 生成したドーパントの酸化物を前記多孔質ガラス体の内 部に拡散せしめ、しかる後、該多孔質ガラス体を透明ガ ラス化することを特徴とする光ファイバ用母材の製造方 法。

1

【請求項2】 少なくともO2及びこれと熱反応してガ ラスの屈折率を高めるドーパントの酸化物を生成する金 属ハロゲン化物とを含む雰囲気で多孔質ガラス体を透明 ガラス化することを特徴とする請求項1記載の光ファイ バ用母材の製造方法。

【請求項3】 ガラスパイプの外周に該パイプの軸に沿 って移動する熱源を配設し、該パイプ内に少なくとも気 相状のガラス原料とO2ガスとを送り込み、これと前記 熱源によって反応し生成したSiO2を前記パイプの内 側表面に多孔質ガラスの状態で堆積し、次いで、少なく ともOz及びこれと反応してガラスの屈折率を高めるド ーパントの酸化物を生成する金属ハロゲン化物とを前記 パイプ内に送り込み、前記熱源によって反応して生成し たドーパントの酸化物を前記多孔質ガラスの中に拡散さ せ、しかる後、該多孔質ガラスを透明ガラス化し、該パ イプを中実化することを特徴とする光ファイバ用母材の 製造方法。

【請求項4】 ガラスパイプ内に少なくとも〇2及びこ れと反応してガラスの屈折率を高めるドーパントの酸化 物を生成する金属ハロゲン化物を送り込みながら多孔質 載の光ファイバ用母材の製造方法。

【請求項5】 金属ハロゲン化物がGeC 14であるこ とを特徴とする請求項1乃至4記載の光ファイバ用母材 の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、コア用石英ガラスに多 量のドーパントを添加する光ファイバ用母材の製造方法 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、光ファイバを製造する方法のう ち、VAD法、OVPO法は生産性、品質の点で優れて おり注目されている。これらの方法は、まず火炎加水分 解反応により、石英ガラス微粒子を生成し、回転する出 発材上に順次堆積し、棒状の多孔質体を作る。次いで、 この多孔質体を所定の雰囲気中で加熱処理し、脱水・溶 融ガラス化し、光ファイバ用母材を作成し、この母材を 線引して光ファイバを得る方法である。

【0003】光ファイバは、主として光の伝搬するコア 部と、その周囲のクラッド部から構成され、コア部の屈 50 質ガラスの中に拡散させ、しかる後、該多孔質ガラスを

折率をn1、クラッド部の屈折率をn2とすると開口数 (N.A.)は数1で定義される。石英をベースとする 光ファイバでは、(1)コアに屈折率を上げる添加剤を 添加する方法、(2)クラッドに屈折率を下げる添加剤 を添加する方法、(3)両者を併用する方法がある。こ こでよく用いられる屈折率を上げる添加剤としてはGe O₂, P₂O₅, A l₂O₃, T i O₂があり、屈折率を下げ る添加剤としてはB2O3、F等がある。

2

[0004]

【数1】

10

N. A. =
$$\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$
 $(n_1 > n_2)$

【0005】このうちGeO2は原料が安価で、比較的 蒸気圧が高く取扱いが容易であること、小量の添加で屈 折率を効果的に上げることができ、最もよく使用される 添加剤である。ところで、GeOzを石英ガラス中に添 加する代表的方法としては、火炎加水分解反応でSiO 2を合成する際に、原料ガス中にGeCl4を混合するこ とによってGeOzの添加された多孔質ガラス体を合成 20 し、これを透明ガラス化する方法である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述の従来方法では、 GeO2を多く添加するために原料ガス中のGeCl4の 分圧を高くするが、やがて飽和し、純粋石英ガラスに対 する屈折率差で高々2%であり、それ以上添加する必要 があっても困難であった。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上述の問題点 を解消するための光ファイバ用母材の製造方法に関する ガラスを透明ガラス化することを特徴とする請求項3記 30 ものであり、その特徴とするところは、SiO2を主成 物とする多孔質ガラス体を形成し、該多孔質ガラス体を 少なくともO2及びこれと熱反応してガラスの屈折率を 高めるドーパントの酸化物を生成する金属ハロゲン化物 とを含む雰囲気におき、生成したドーパントの酸化物を 前記多孔質ガラス体の内部に拡散せしめ、しかる後、該 多孔質ガラス体を透明ガラス化する方法である。

> 【0008】また、より効果的には、少なくとも02及 びこれと熱反応してガラスの屈折率を高めるドーパント の酸化物を生成する金属ハロゲン化物とを含む雰囲気で 40 多孔質ガラス体を透明ガラス化することが好ましい。

【0009】他の実現手段としては、ガラスパイプの外 周に該パイプの軸に沿って移動する熱源を配設し、該パ イプ内に少なくとも気相状のガラス原料とOzガスとを 送り込み、これと前記熱源によって反応し生成したSi O2を前記パイプの内側表面に多孔質ガラスの状態で堆 積し、次いで、少なくともO2及びこれと反応してガラ スの屈折率を高めるドーパントの酸化物を生成する金属 ハロゲン化物とを前記パイプ内に送り込み、前記熱源に よって反応して生成したドーパントの酸化物を前記多孔 3

透明ガラス化し、該パイプを中実化する方法であり、 【0010】ガラスパイプ内に少なくともO2及びこれ と反応してガラスの屈折率を高めるドーパントの酸化物 を生成する金属ハロゲン化物を送り込みながら多孔質ガ ラスを透明ガラス化することが好ましい。上記の金属ハ ロゲン化物としてはGeCl4が最も適切な原料である。

[0011]

【作用】気相反応によりGe〇₂をドープした石英ガラスを合成する場合は、まず、SiС 14が酸化反応によってSiО₂の粒子を生成し、次いで、この粒子の周辺にGeО₂が析出・固溶して形成される。この反応において、GeО₂は核形成能力が低く、単独でGeО₂の粒子が堆積することは難しい。従って、SiО₂粒子の生成温度以下ではGeО₂のみの粒子体が形成されない。【0012】一方、SiО₂が生成する温度領域ではGeО₂の蒸気圧が高いために揮散し、原料ガス中のGeС 14の分圧を高くしても添加できる量には限界がある。これに対して、本発明は既に別工程で形成した多孔質ガラス体を〇₂およびGeС 14の雰囲気中に導入し、これを加熱する方法であるからSiО₂の生成温度とは独立にGeО₂を生成することができ、これが多孔質ガラスの表面粒子に固溶し、徐々に内部へ拡散するのである。

【0013】また、このようにドーパントを添加した多孔質ガラス体を透明ガラス化するに際し、 O_2 およびG e C 1_4 を含む雰囲気に保持することにより多孔質ガラス体中に含まれるG e O_2 の揮散を防ぐことができる。【0014】

【実施例】

(実施例1) 図1は本発明の一実施例に係わる光ファイバ用母材の製造方法の説明図であり、1は多孔質ガラス体を保持する支持棒、2は光ファイバのコアを構成するための多孔質ガラス体、3は石英ガラスからなる反応容器、4は熱源、5は焼結炉である。まず、反応容器3の中にGeC14:50cc/分、O2:500cc/分の割合で導入し、容器内の温度を熱源4により800℃に保持して多孔質ガラス体2を1Hr加熱処理した。次いで容器内の雰囲気を1気圧のHeガスに保ち、1400℃で3時間加熱して透明ガラス化した。このガラスを40分析したところ、GeO2の濃度は50重量%であり、ほぼ均一に添加されていたが外周部にGeO2の少ない部分があった。

【0015】(実施例2) 反応容器3の中にGeC1 4:50cc/分、O2:500cc/分の割合で導入 し、容器内の温度を熱源4により800℃に保持して多 孔質ガラス体2を1Hr加熱処理した。次いで容器内の 雰囲気は変えずに内部の温度を1400℃に加熱して3 Hr保持したところ多孔質ガラス体は透明ガラス体となった。このガラスを分析したところ、GeO2の濃度は 50重量%であり、均一に添加されていた。

【0016】(実施例3) 図2は本発明の他の実施例に係わる光ファイバ用母材の製造方法の説明図であり、11は石英ガラスからなるパイプ、12はガラス旋盤の回転支持機槽、13は酸水素バーナーからなる熱源、14は多孔質ガラス層、15は回転方向を示す。まず、パイプ11の中に○2ガス:500cc/分、SiCl4ガス:100cc/分の割合で導入し、パイプ11を矢印15の方向に回転させながら熱源13でパイプ内が1250℃になるように加熱しながら軸方向に往復移動しSiO2からなる多孔質ガラス層をパイプの内壁に形成した。

4

【0017】続いて、上記のパイプの中にO2ガス:5 00cc/分、GeCl4:50cc/分の割合で導入 し、上記と同様にパイプ内が1000℃になるように加 熱して、GeO2を生成し、同時にSiO2の多孔質ガラ ス層に固溶させ拡散させ多孔質ガラス層14を形成し た。次いで、パイプ内が1300℃になるまで熱源13 のみを調整して多孔質ガラスを透明ガラス化し、さらに 熱源13を1600℃に昇温して中実化した。このよう にして得られた母材を線引してファイバを作成した。フ ァイバのコアとクラッドの屈折率差は3%、波長1.3 μmにおける伝送損失は0.67dB/kmであった。 【0018】(実施例4) まず、パイプ11の中に〇 2ガス:500cc/分、SiCl4:100cc/分、 GeC14:30cc/分の割合で導入し、パイプ内が 1150℃になるように前記同様に熱源13によって加 熱して多孔質ガラス層をパイプの内壁に形成した。その 後の工程は実施例2と同様の条件によって光ファイバを 30 作成した。ファイバのコアとクラッドの屈折率差は3. 5%、波長1. 3μmにおける伝送損失は0. 69dB /kmであった。

【0019】(比較例) 石英パイプ11の中にO2ガス:500cc/分、SiC14:100cc/分、GeC14:30cc/分の割合で導入し、パイプ内が1250℃になるように前記同様に熱源13によって加熱して直接ガラス層をパイプの内壁に形成した。次いで、原料ガスの供給を停止し、熱源13を1600℃に昇温して上記のパイプを中実化し、これを線引きしてファイバを作成した。ファイバのコアとクラッドの屈折率差は0.7%、波長1.3μmにおける伝送損失は0.73dB/kmであった。

[0020]

【発明の効果】以上述べたように、本発明に係わる光ファイバ用母材の製造方法によれば、一旦、多孔質ガラス体を形成し、その後、酸素と反応して屈折率を高めるドーパントの酸化物を生成する金属ハロゲン化物を酸素と共に供給した雰囲気でこれを加熱処理するので、SiO 2粒子の生成温度に影響されることなく独立にドーパントを添加するのに最適な温度で効率よく、かつ、均一に

(4)

特開平5-330845

5

行うことができる。実施例ではドービング物質として酸化ゲルマニウムについて説明したが、その他酸化リン、酸化チタン等に適用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係わる光ファイバ用母材の 製造方法の説明図である。

【図2】本発明の他の実施例に係わる光ファイバ用母材の製造方法の説明図である。

【符号の説明】

1:支持棒

2:多孔質ガラス体

3:反応容器

4:熱源

5:焼結炉

11:ガラスパイプ

12:ガラス旋盤の回転支持機槽

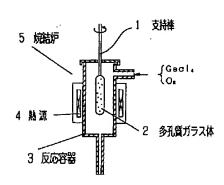
13:熱源

14:多孔質ガラス層

15:回転方向

10 16:原料ガス等の導入方向

【図1】



【図2】

6

